

Title (en)

Method for centering of electron beam.

Title (de)

Verfahren zum Zentrieren eines Elektronenstrahles.

Title (fr)

Procédé pour centrer une faisceau d'électrons.

Publication

EP 0490068 A1 19920617 (DE)

Application

EP 91118100 A 19911024

Priority

CH 395590 A 19901213

Abstract (en)

In guiding and centring an electron beam (3) by means of a magnetic field, arranged orthogonally with respect to the axis of the electron beam, in a vacuum coating apparatus (1), the signals which are decisive for the configuration and control of the magnetic field and its axis of rotation, respectively, are supplied by detecting the focal spot of the electron beam on the surface of the evaporator source (4) by means of a video system or by means of a video camera (42) and a corresponding image analyser (43). <IMAGE>

Abstract (de)

Beim Führen und Zentrieren eines Elektronenstrahles (3) mittels einem zur Achse des Elektronenstrahles orthogonal angeordneten Magnetfeldes in einer Vakuumbeschichtungsanlage (1) werden die Signale, welche für die Ausgestaltung und Steuerung des Magnetfeldes, resp. dessen Rotationsachse massgebend sind, durch Detektieren des Brennfleckes des Elektronenstrahles auf der Oberfläche der Verdampferquelle (4) mittels eines Videosystems resp. mittels einer Videokamera (42) und einem entsprechenden Bildauswerter (43) geliefert. <IMAGE>

IPC 1-7

H01J 37/30; **H01J 37/304**; **H01J 37/305**

IPC 8 full level

C23C 14/30 (2006.01); **C23C 14/54** (2006.01); **H01J 37/04** (2006.01); **H01J 37/06** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

H01J 37/04 (2013.01 - EP US); **H01J 37/06** (2013.01 - KR)

Citation (search report)

- [YD] EP 0381912 A1 19900816 - BALZERS HOCHVAKUUM [LI]
- [A] EP 0379739 A2 19900801 - LEYBOLD AG [DE]
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 56 (E-302)(1779) 12. März 1985 & JP-A-59 195 825 (NIPPON DENSHI) 11. Juli 1984

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0490068 A1 19920617; **EP 0490068 B1 19951011**; DE 59106675 D1 19951116; JP 3338467 B2 20021028; JP H04268072 A 19920924; KR 100246488 B1 20000315; KR 920013586 A 19920729; US 5229570 A 19930720

DOCDB simple family (application)

EP 91118100 A 19911024; DE 59106675 T 19911024; JP 33054891 A 19911213; KR 910021994 A 19911202; US 79572291 A 19911121